PAT-NO:

JP404093648A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 04093648 A

TITLE:

GAS CHROMATOGRAPH

PUBN-DATE:

March 26, 1992

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

MUTO, HIROYUKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

YAMATAKE HONEYWELL CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP02205062

APPL-DATE:

August 3, 1990

INT-CL (IPC): G01N027/18, G01N030/66

US-CL-CURRENT: 73/23.35

ABSTRACT:

PURPOSE: To realize high sensitivity and service life long at the same time by installing a chip-form microdiaphragm sensor being constituted from a film heater on a substrate, and detecting any variation in the heater's resistance value being produced by heat conductivity in each gas component.

CONSTITUTION: In a microdiaphragm sensor 21, since its pattern form is very small and thin, a heat time constant ia very small as little as to such an extent of several ms or so. Accordingly, a current being fed to a film heater 22 of the microdiaphragm sensor 21 from a constant voltage diode 11 is intermitted by a switch 13 into a pulse current through which the film heater 22 is driven, thus a resistance value of this film heater 22 is varied according to heat conductivity in each gas component to be sepated by a column, and this varied value is detectable as a voltage (v) of a detector 15. With this constitution, a span of total time in a high temperature state of the film heater 22 is reducible.

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio

69 日本国特許庁(JP)

(1) 特許出願公開

平4-93648 @ 公 開 特 許 公 報(A)

Sint. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号

63公開 平成 4年(1992) 3月26日

G 01 N 27/18 30/66 7370-2 J 7621 - 2 J

寒香請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

ガスクロマトグラフ 60発明の名称

> 願 平2-205062 创特

頤 平2(1990)8月3日 20出

裕 行 60発 明 者

東京都大田区西六郷 4 丁目28番 1 号 山武ハネウエル株式

会社蒲田工場内

山武ハネウエル株式会 願 人 る出

東京都渋谷区渋谷2丁目12番19号

社

外3名 政樹 70代理人 弁理士·山川

1. 発明の名称 ガスクロマトグラフ

2. 特許請求の範囲

キャリアガスによって移送されるサンプルガス をカラムに導いて各ガス成分に分離し、これを熱 伝導度検出器で検出して分析を行うガスクロマト グラフにおいて、前記熱伝導度検出器は基板上に 薄膜のヒータから構成されるマイクロダイヤフラ ムセンサから成り、該マイクロダイヤフラムセン サの薄膜ヒータに一定の電流を供給してそれを駆 動する直流電源と、該直流電源より前記マイクロ ダイヤフラムセンサへ供給する電流を所定のサン プリング周期に従って断続するスイッチ手段と、 前記薄膜ヒータに流れる断続電流により加熱して 前記ガス成分の熱伝導度によって生じる該薄膜ヒ - 夕の抵抗値の変化を出力電圧として検出する検 出回路とを備えたことを特徴とするガスクロマト グラフ.

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、キャリアガスによって移送されるサ ンプルガスをカラムに導いて各ガス成分に分離し、 これを熱伝導度検出器で検出して分析を行うガス クロマトグラフに関し、特にその熱伝導度検出器 の駆動回路に関するものである。

〔従来の技術〕

石油化学プロセスや鉄鋼プロセスなどにおいて プロセスガスの成分分析を行い、その分析結果に 基づいて各プロセス工程を監視したり各種制御を 行ったりするための検出装置としてガスクロマト グラフが従来から一般に用いられている。

第5図はこの種のガスクロマトグラフの基本的 構成を示す図で、恒温槽を形成し所定温度に保持 されるアナライザ本体1、このアナライザ本体1 内に配置されたサンプルバルプ2、カラム3およ び検出器4、計量管5、ヘリウム等の不活性ガス からなるキャリアガスCGを所定圧に減圧する減 圧弁6等を備え、測定時にサンプルバルプ2に流 路を実線の状態から破線の状態に切替えることに 一方、非測定にはサンプルバルブ2の流路を実 線図示の状態に切替えることにより、キャリアガ スCGをカラム3および検出器4へ導いている。

ところで、このようなガスクロマトグラフにおいて熱伝導度検出器(以下TCDセンサという) としてはフィラメントやサーミスタが使用されている。この種のセンサは定電流で駆動し、熱伝導

度と長寿命を同時に実現可能にしたガスクロマト グラフを提供することを目的をする。

(課題を解決するための手段)

〔作用〕

本発明においては、マイクロダイヤフラムセンサに供給する電流を所定のサンプリング周期によって断続することにより、マイクロダイヤフラムセンサが高温になっている時間のトータルを減ら

度の変化が抵抗値の変化となるため、出力が電圧 として取り出せることになる。

また、TCDセンサとしてマイクロダイヤフラムセンサを用いる方法がある。このマイクロダイヤフラムセンサは、半導体製造プロセスを用いてシリコン等の基板上にミクロンオーダーで微細な常に小さいため、スペースファクターが良い、TCD検出器のデットスペースを小さくできる、無時定数が小さい等の利点がある。

(発明が解決しようとする課題)

しかし、かかるマイクロダイヤフラムセンサを 用いたガスクロマトグラフでは、感度を上げるために印加電流(または電力)を大きくするとマイクロダイヤフラムセンサは高温(4mAで250 で)になるため、センサの寿命が著しく短くなる という問題があった。

本発明は以上の点に鑑み、かかる従来の問題点を解消するためになされたもので、マイクロダイヤフラムセンサをTCDセンサとして用いて高感

すことができ、そのセンサの寿命を延ばすことが できる。

(実施例)

以下、本発明を図面に示す実施例に基づいて詳 細に説明する。

第1図は本発明の一実施例によるでであるに であるにというとというでは であり、このがイオード11のでは であり、このがイオード11のでは であり、このがイオード11のでは であり、イッチ13を通しており、このがイオードであり、イッチ13を通しており、できるに であり、イッチ13を加ており、できるがセンサ検出回路15に入力に行った。 ながセンサ検出回路15に入力に行った。 をレンガが接地されたよってのに がなっての反転力が接地されたと、でいるでは でいるマイクロが抵抗16に入力では でいるマイクロがはないないでは でいるでは、アンプロには でいるでは、アンプロには でいるでは、アンプロには でいるでは、アンプロには でいるでは、アンプロでは でいるでは、アンプロでは、アンプロでは でいるでは、アンプロでは、アンプロでは でいるでは、アンプロでは、アンプロでは でいるでは、アンプロでは、アンプロでは、アンプロでは でいるでは、アンプロででは、アンプロでで ヒータ 2 2 の抵抗値の変化に応じた電圧を出力として検出するものとなっている。この場合、スイッチ 1 3 は予め決められたサンプリング周期のパルス S Pによってオン、オフ動作する。なお、図中 1 8 は抵抗である。

等の異方性エッチング方法によりエッチングすることにより空隙化して、断面形状が略逆台形状のパターンを持つ空隙部26を形成する。これにより、その空隙部26の上部には、シリコン基板20からダイヤフラム状に空間的に隔離され、その基板より薄膜ヒータ22が熱的に絶縁されてする。なり、高速化シリコンなどの保護膜によって被覆によって被覆によって被覆によって強度によって強度によって強度によって強度によって強度によって強度によって強力スの流れを示す。

このような構造のマイクロダイヤフラムセンサ 2 1 は、薄膜ヒータ 2 2 を所定の温度に加熱した うえ、該薄膜ヒータ 2 2 の抵抗値がガス成分の熱 伝導度によっ変化するのを利用してそのガスの濃度を検出できる。また、薄膜ヒータ 2 2 を加熱した状態で、測定ガスの流れがあると上流側温度センサ 2 3 は冷却されて抵抗値が増加す 流側温度センサ 2 4 は加熱されて抵抗値が増加す

るのを利用してその差から流量を検出することも ・ できる。

このとき、スイッチ13の動作タイミングつま りサンプリング周期Tsはガスクロマトグラフに おけるサンプリング周期(通常20ms~100 ms程度)に合わせてマイクロダイヤフラムセン サ21へ供給する電流のオン、オフを繰り返す。 これにより、第4図に示すような取る成分ガスのクロマトグラフィを想定したとき、検出回路15から得られる出力電圧vの値は離散的な波形!になる。これに対し、従来による定電流駆動のときの出力電圧の値は連続的な波形!となる。その結果、マイクロダイヤフラムセンサ21の薄膜ヒータ22の高温状態のトータル時間を減らすことができる。

(発明の効果)

以上説明したように本発明によれば、TCDセンサとしてマイクロダイヤフラムセンサを用い、このマイクロダイヤフラムセンサに流す電流を断続的にオン、オフさせてパルス駆動するようにしたので、マイクロダイヤフラムセンサが高温になっている時間のトータルを減らすことにより、そのセンサの長寿命化がはかれ、ガスクロマトグラフの信頼性向上に優れた効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例によるマイクロダイ ・ヤフラムセンサ駆動回路の回路構成図、第2図は 第1図のマイクロダイヤフラムセンサのパターン 構造の一例を示す概略平面図、第3図(a)及び(b)は 上記実施例の動作説明に供する説明図、第4図は 或る成分ガスのクロマトグラフィにおいて本発明 と従来例とを比較して表した出力電圧の波形を示 す図、第5図はガスクロマトグラフの基本的構成 図である。

11・・・定電圧ダイード、13・・・スイッチ、14・・・バッファ、15・・・センサ検出 回路、21・・・マイクロダイヤフラムセンサ、 22・・・薄膜ヒータ。

特許出職人 山武ハネウエル株式会社 代理人 山川 政樹

1 X



